

## 高真空熱処理炉



### ・特徴

本装置は高真空状態において500℃近くまで昇温し、被固体の脱ガス化を行う為の装置です。本装置の排気系はドライポンプとクライオポンプを採用しており、オイルフリーの環境に対応しております。到達圧力は $\times 10^{-5}$ Pa 台ですので、非常にクリーンな環境で脱ガス処理を行うことが可能です。

また温度制御方法としてプログラム温調計を採用しておりますので、パターンに応じた昇温が可能です。

クリーンルーム内の設置用に漏水センサーの採用や、安全面での配慮として冷却水の温度監視センサーを採用しております。

### ・仕様

到達圧力	5.0 $\times 10^{-5}$ Pa 以下※常温・無負荷・容器空状態時
排気速度	到達圧力迄 60 分以内
加熱温度	最高 500℃
真空室径	1000mmW $\times$ 1000mmD $\times$ 500mmH(3 室構造) SUS304 電解研磨処理
開閉機構	天板ウォームギア開閉方式
加熱機構	ヒーター種：プレートヒーター(75V4KW) $\times$ 3 台 加熱範囲：500mmW $\times$ 150mmH(1 台あたり) 昇温時間：500℃迄 30 分以内 加熱制御：プログラム温調計
真空排気系	ドライポンプ+メカニカルブースターポンプ：17500L/min クライオポンプ：10000L/sec
真空計	ピラニ真空計/電離真空計